

磁控溅射台

Physical Vapor Deposition

PVD500A等



中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司设备



中国科学院微电子研究所设备



主要技术与性能指标

- 系统极限真空度： $\leq 6 \times 10^{-5}$ Pa
- 溅射材料：Au、Ag、Pt、W、Mo、Ta、Ti、Al、Si 等
- 片内镀膜厚度均匀性：4 英寸样片片间 $\leq \pm 2.9\%$ ；批间膜厚均匀性 $\leq \pm 3.9\%$ （连续 10 炉）

主要应用

各种薄膜的制备、研究

代表性应用成果

- 装饰镀膜，如灯具表面的薄膜制备等
- 夜视仪镜片表面的薄膜制备等
- 金属导电膜，如锂电池导电薄膜等

主要用户单位	南京大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、龙焱能源科技有限公司等		
研制单位	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、中国科学院微电子研究所		
联系方式	何 萌	010-62049399, 13581817539	hemeng@ime.ac.cn
	万向明	024-23826855, 13998191237	wanxm@sky.ac.cn